

## **RS-2000 Жидкая паяльная маска RS-2000 производства компании ABQ Electronic Material CO., LTD.**

RS-2000 является двухкомпонентной термоотверждаемой жидкой

фотопроявляемой защитной паяльной маской, которая после сушки выпариванием образует пленку, обрабатываемую в водном растворе карбоната калия или натрия, или растворителе.

Резист и отвердитель перед использованием должны быть тщательно смешаны в соотношении

3:1 вес/вес. Отвердитель должен добавляться к резисту.

Для обеспечения полного смешения компонентов рекомендуется использовать механическое смешивание.

Перед использованием RS-2000 обеспечить полную очистку всех медных поверхностей, отсутствие пятен и сушку.

RS-2000 может использоваться для любых типов вертикальных и горизонтальных установок сеткографической печати.

Очень важна хорошая предварительная сушка покрытия.

Экспонирование: RS-2000 негативные и могут обрабатываться в любых рамах экспонирования при использовании легированных железом ртутных УФ ламп с длиной волны 300 – 400 нм.

Появление: RS-2000 легко проявляется в растворе карбоната калия или натрия. Рекомендуемая концентрация карбоната -  $10 \pm 2$  г/л. Рабочий диапазон pH водного раствора карбоната: 11,3 – 10,8. Для обеспечения качества проявления рекомендуется не понижать pH раствора проявления ниже 10,8. Рекомендуемый диапазон температур 30 - 40°C, оптимально 35 - 38°C.

УФ ОБЛУЧЕНИЕ: Перед окончательным отверждением может требоваться УФ облучение.

ОТВЕРЖДЕНИЕ (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СУШКА): Рекомендуемый цикл сушки 140 - 150°C в течение 60 - 90 мин. Оптимально 60 мин при 150°C.

Время сушки следует считать с момента достижения в печи заданной температуры.

Хранение: Рекомендуемая температура хранения (20°C), вдали от источников тепла и солнечного света